

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Mai 2008 (08.05.2008)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2008/052636 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C09K 3/14 (2006.01) **H01L 21/311** (2006.01)
C09K 13/02 (2006.01) **H01L 31/18** (2006.01)
H01L 21/306 (2006.01)

(74) Gemeinsamer Vertreter: **MERCK PATENT GMBH**;
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2007/008662

(22) Internationales Anmeldedatum:
5. Oktober 2007 (05.10.2007)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2006 051 952.3
1. November 2006 (01.11.2006) DE

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **MERCK PATENT GMBH** [DE/DE]; Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **STOCKUM, Werner** [DE/DE]; Waldstrasse 59, 64354 Reinheim (DE). **KLEIN, Sylke** [DE/DE]; Am Huehnerbusch 17, 64380 Rossdorf (DE). **KUEBELBECK, Armin** [DE/DE]; Augartenstrasse 45, 64625 Bensheim (DE).

(54) Title: ETCHING PASTE CONTAINING PARTICLES FOR SILICON SURFACES AND LAYERS

(54) Bezeichnung: PARTIKELHALTIGE ÄTZPASTEN FÜR SILIZIUMOBERFLÄCHEN UND -SCHICHTEN

(57) Abstract: The present invention relates to etching media containing particles in the form of etching pastes suitable for the full-surface, or selective etching of finest lines or structures in silicon surfaces and layers, and glass-like surfaces being formed of suitable silicon compounds. The present invention further relates to the use of the pastes according to the invention in methods for etching such surfaces.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft partikelhaltige Ätzmedien in Form von Ätzpasten, welche geeignet sind zum ganzflächigen oder selektiven Ätzen von feinsten Linien oder Strukturen in Siliziumoberflächen und -schichten sowie in glasartige Oberflächen, welche aus geeigneten Siliziumverbindungen gebildet werden. Die vorliegende Erfindung betrifft auch die Verwendung der erfindungsgemäßen Pasten in Verfahren zum Ätzen solcher Oberflächen.



WO 2008/052636 A1